

MEXA-2000SPCS シリーズ

製品概要

型 式	MEXA-2000SPCS	MEXA-2100SPCS	MEXA-2200SPCS	MEXA-2300SPCS
適合規格	UN/ECE R83 (Rev.3 Amend.2) UN/ECE R49 改定ドラフト*1 (ECE/TRANS/W.P.29/GRPE/2010/7)	—	UN/ECE R83 (Rev.3 Amend.2) UN/ECE R49 改定ドラフト (ECE/TRANS/W.P.29/GRPE/2010/7)	—*2
測定原理	レーザ散乱式凝縮粒子カウンタ (GPC)			
検出粒径(下限)	粒径径23 nm にて計数効率50 ± 12%、粒径径41 nm にて計数効率90% 以上			
測定成分・レンジ	固体粒子状物質の粒子数 0-10000 個/cm ³ ~ 0-50000 個/cm ³ (装置内希釈後)			
サンプリング温度	47°C ± 5°C (希釈サンプリング)	最高350°C (ダイレクトサンプリング)*3	47°C ± 5°C (希釈サンプリング)	最高350°C (ダイレクトサンプリング)*3
希釈サンプル温度	1次希釈器 (PND1): 191°C ± 10°C 蒸発管: 350°C ± 10°C 2次希釈器 (PND2): 35°C 以下			
ダイリューションファクタ設定範囲	1次希釈器 (PND1): 10 ~ 200 2次希釈器 (PND2): 15	DSU 内希釈器: 10 1次希釈器 (PND1): 10 ~ 200 2次希釈器 (PND2): 15	1次希釈器 (PND1): 10 ~ 200 2次希釈器 (PND2): 15	DSU 内希釈器: 10 1次希釈器 (PND1): 10 ~ 200 2次希釈器 (PND2): 15
リダクションファクタ (PCRF)	0.95 < fr(30 nm) / fr(100 nm) < 1.3 0.95 < fr(50 nm) / fr(100 nm) < 1.2			
揮発性粒子除去効率	99% 以上 (粒径30 nm かつ濃度10000 個/cm ³ 以上のC ₄₀ 粒子にて)			
希釈精度	設定値の ± 10% 以内			
設置環境	単体使用時 (標準): 温度 5°C ~ 30°C, 相対湿度 80% 以下 CLU 使用時 (オプション): 温度 5°C ~ 45°C, 相対湿度 80% 以下			
電 源	AC 200/220/230/240V (± 10%、ただし 250V 以下)、50/60 Hz (± 1.0 Hz)、単相 (注文時に指定のこと)			
電源容量 (トランスファ管含む)	本体: 最大 2.3 kVA 本体+ オプション: 最大 4.5 kVA	本体: 最大 2.5 kVA 本体+ オプション: 最大 4.4 kVA	本体: 最大 2.4 kVA 本体+ オプション: 最大 4.3 kVA	本体: 最大 2.6 kVA 本体+ オプション: 最大 4.5 kVA
外形寸法 (突起物を除く) / 質量				
基本ユニット (トランスファ管・制御部・オプションユニット別)	434 (W) × 731 (D) × 600 (H) mm 約 115 kg	434 (W) × 845 (D) × 600 (H) mm 約 120 kg	434 (W) × 910 (D) × 600 (H) mm 約 140 kg	434 (W) × 910 (D) × 600 (H) mm 約 145 kg
オプションユニット	CYU: 290 (W) × 146 (D) × 236 (H) mm *4 約 4 kg SRU: 300 (W) × 550 (D) × 450 (H) mm 約 35 kg CLU: 570 (W) × 850 (D) × 1190 (H) mm 約 80 kg (専用架台込み) DFC: 464 (W) × 550 (D) × 320 (H) mm 約 38 kg LCU: 350 (W) × 690 (D) × 670 (H) mm 約 35 kg VGU: 550 (W) × 300 (D) × 450 (H) mm 約 20 kg			

*1 フルトンネル希釈計測限定。

*2 UN/ECE R49 改定ドラフトに準拠した測定も可能です。詳細については別途お問い合わせください。

*3 本装置のサンプリング温度条件は、「DSU 本体が 350°C 以下となる範囲」です。詳細については、弊社までお問い合わせください。

*4 寸法は顧客仕様により異なります。